

مجلهٔ پژوهش فیزیک ایران، جلد ۱۱، شمارهٔ ۴، زمستان ۱۳۹۰



(دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۱۰/۴ ؛ دریافت نسخهٔ نهایی: ۱۳۹۰/۱۰/۲۰)

. .

بعدی هستند، که موضوع رسانش آنها با کشف خواص رسانش بسپار پلیاستیلن وارد عرصهٔ علم فیزیک شد، به این معنی که پلیاستیلن اولین نسل بسپارهای رسانا به شمار میرود [۱۰] و تا کنون مطالعات زیادی بر روی این بسپار انجام شده است [۸ ۱۱و ۱۲]. علیرغم تحقیقات زیادی که بر روی بسپارها انجام شده است، هنوز پرسشهای اساسی زیادی دربارهٔ ویژگیهای رسانش این مواد در ذهن دانشمندان وجود دارد. هدف این تحقیق مطالعهٔ تحلیلی ترابرد الکتریکی بسپار پلیاستیلن با در نظر گرفتن اثر انرژیهای پرش پیوند هیدروژن-کربن است. برای این منظور به مطالعهٔ تحلیلی رسانش الکتریکی یک

مطالعه و تحقیق دربارهٔ سامانه های مولکولی یکی از مهم ترین زمینه های تحقیقاتی در چند دههٔ اخیر بوده است [۱] و در میان این سامانه های مولکولی سامانه های یک بعدی، مانند سیم های مولکولی نقش مهمی را در پایه و اساس فن آوری نانو ایفا کرده اند [۲-۵]. سامانه های یک بعدی در مقابل تغییرات میدان خارجی یا ویژگی های ذاتی مانند مکان ناخالصی در یک سیم [۶و۷] و قدرت دوپارش (اختلاف قدرت پیوندهای یگانه و دوگانه) [۸] بسیار حساس هستند که موجب استفادهٔ آنها در قطعات مولکولی مانند حسگرهای زیستی و شیمیایی شده است [۹].





شکل۱. نمایش طرحوارهای از یک بسپار شانه-مانند با انرژی پرش متناوب در شاخهٔ اصلی (پلی استیلن) که متصل به دو نیمسیم نیمه متناهی است.

 $\beta_{C}(1-\delta)$ و $\beta_{C}(1-\delta)$ به ترتیب انرژی پرش پیوند دوگانه و یگانه بین دو اتم متوالی در راستای محور بسپار را نشان می دهند ($\circ = \delta$ معادل یکسان بودن تمام پیوندها است). N تعداد جایگاههای مؤثر (اتمهای کربن) در بسپار است. همچنین \tilde{c}_{C} انرژی بازبهنجارش شدهٔ جایگاهها است که به صورت زیر به دست می آید [۱۴]

$$\tilde{\varepsilon}_C = \varepsilon_C + \frac{\beta_{CH}^{\mathsf{r}}}{\varepsilon - \varepsilon_H},\tag{(\texttt{Y})}$$

که در آن *B*_{CH} انرژی پرش الکترون برای پیوند هیدروژن–کربن، *E* و *E*_H بهترتیب انرژی جایگاهی الکترون در اتمهای کربن و هیدروژن هستند. هامیلتونیهای هادیها نیز بهصورت زیر هستند [1۵]

$$\begin{split} H_{L} &= \varepsilon_{L} \sum_{i=-\infty}^{\circ} |i\rangle \langle i| \\ &+ \beta_{L} \sum_{i=-\infty}^{-1} \left(|i\rangle \langle i+1| + |i+1\rangle \langle i| \right), \\ H_{R} &= \varepsilon_{R} \sum_{i=N+1}^{\infty} |i\rangle \langle i| \\ &+ \beta_{R} \sum_{i=N+1}^{\infty} \left(|i\rangle \langle i+1| + |i+1\rangle \langle i| \right), \\ \varepsilon_{L(R)} &= 0, \text{ and } 0,$$

انرژی جایگاهی اتمها در نیمسیم سمت چپ (راست) هستند. همچنین هامیلتونیهای اتصال بسپار به هادیها به ایـن صـورت هستند[۱۵]

$$\begin{split} H_{PL} &= \beta_{PL} (|\circ><\vee|+|\vee><\circ|), \\ H_{PR} &= \beta_{PR} (|N> (δ)$$

که در آن ($\beta_{PL(R)}$ انرژی پرش بین بسپار و هادی سمت چپ (راست) است. تابع گرین بسپار در حضور هادیها به صورت زیر نوشته می شود [۱۶] $G_{P} = \frac{G_{\circ P}}{G_{\circ P}}$

$$G_P = \frac{1}{I - G_{\circ P} H_{PL} G_L H_{LP} - G_{\circ P} H_{PR} G_R H_{RP}},$$

یک بعدی اید ال پرداخته و تأثیر طول بسپار و قدرت دوپارش را بر روی رسانش الکتریکی و چگالی حالت های انرژی این سامانه به طور تحلیلی بررسی میکنیم. مطالعهٔ رسانش الکتریکی براساس رابطهٔ لانداؤر در نظریهٔ پاسخ خطی است، که بیان میکند رسانش الکترونی سامانه با ضریب عبور الکترونی آن متناسب است [1۳].

در این قسمت با استفاده از روش تابع گرین در رهیافت بستگی قوی به مطالعهٔ نظری یک سامانه شامل یک بسپار که بین دو هادی یک بعدی ایدهآل قرار گرفته است، می پردازیم. مطابق شکل ۱ این بسپار دارای یک ساختار شانه-مانند شامل انرژیهای پرش متناوب در شاخهٔ اصلی خود است. این مدل را می توان برای توصیف خواص ترابردی بسپارهای پلی استیلن-مانند به کار برد. هامیلتونی کل سامانه با فرض مشابه بودن دو هادی سمت چپ و راست، در تقریب همسایههای اول به صورت زیر است

$$H = H_L + H_{PL} + H_P + H_{PR} + H_R,$$
(1)
که در آن $H_P, H_{PL(R)}, H_{L(R)}$ بهترتیب هـامیلتونی نـیمسیه

سمت چپ (راست)، هامیلتونی اتصال بسپار به نیمسیم سـمت چپ (راست) و هامیلتونی بسپار منزوی است. هامیلتونی بـسپار شانه-مانند منزوی بهصورت زیر بیان میشود

$$H_{P} = \tilde{\varepsilon}_{C} \sum_{i=1}^{N} |i\rangle \langle i|$$

$$+ \beta_{C} \sum_{i=1}^{N-1} (1 + \delta(-1)^{i+1})$$

$$(|i\rangle \langle i+1| + |i+1\rangle \langle i|)$$
(Y)

که در آن ^{۱+۱}(۱–۵(–۱) ضریب انرژی پرش بین جایگاههای *i و i*+۱ است و در واقع نشان دهندهٔ قدرت دوپارش است. بنابراین

که در آن
$$G_{\circ P}$$
 تابع گرین بسپار منزوی و $G_{L(R)}$ تابع گرین
هادی چپ (راست) است.
میتوان ضریب عبور الکتریکی و چگالی حالتها (DOS) را بر
حسب آخرین عنصر سطر اول ماتریس تابع گرین سامانه،
حسب آخرین عنصر سطر اول ماتریس تابع \mathcal{L}_{L} ین سامانه،
 $T(\varepsilon) = 4 \operatorname{Im} \sigma_L \operatorname{Im} \sigma_R | (G_P)_{1,N}|^7,$ (V)

و

$$\mathrm{DOS}(\varepsilon) = \frac{\gamma}{\pi} \mathrm{Im} \frac{\partial \ln (G_P)_{\gamma,N}}{\partial \varepsilon'} \bigg|_{\varepsilon' = \varepsilon}.$$
 (A)

که در رابطهٔ (۷) $\sigma_{L(R)}$ خود انرژی بسپار به دلیل اتصال با هادی چپ (راست) بوده و دارای شکل زیر است [۵۵و ۱۹] $\beta_{PL(R)}^{\gamma} \left(\varepsilon - \varepsilon_{L(R)} \right) + \left(\varepsilon - \varepsilon_{L(R)} \right)^{\gamma}$

$$\sigma_{L(R)} = \frac{\beta_{PL(R)}}{\beta_L} \left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_{L(R)}}{r\beta_L} + \sqrt{\left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_{L(R)}}{r\beta_L}\right)} - 1 \right), \quad (\mathbf{A})$$

با فرض مشابه بودن هادی ها و اتصال های سمت چپ و راست R با فرض مشابه بودن هادی ها و اتصال های سمت چپ و راست $\sigma_L = \sigma_R$ (۸) و (۸) برای آن خودداری میکنیم. با نگاهی به روابط (۷) و (۸) می توان فهمید که برای ارائهٔ فرمول بندی تحلیلی مسئله نیاز به شکل تحلیلی عنصر $(G_P)_{1,N}$ است. بدین منظور از رهیافت ذکر شده در مرجع [۰۰] استفاده میکنیم و داریم

$$(G_P)_{\mathcal{N},N} = \frac{(\mathcal{N} - \mathcal{N})/\mathcal{Y}}{\beta_C \tilde{D}_N(\varepsilon,\sigma)},\tag{11}$$

که در آن $ilde{D}_N(arepsilon,\sigma)$ دترمینان وارون ماتریس تابع گرین بـسپار در حضور هادیها است و به کمک بسط تابع دترمینان بـه ازای Nهای فرد به شکل زیر بیان می شود

$$\begin{aligned} &(\varepsilon - \tilde{\varepsilon}_C) \tilde{D}_N(\varepsilon, \sigma) = \left((\varepsilon - \tilde{\varepsilon}_C) - \mathbf{Y} \sigma \right) D_N(\varepsilon) \\ &+ \sigma \left(\sigma(\varepsilon - \tilde{\varepsilon}_C) - \mathbf{Y}(\mathbf{Y} + \delta^{\mathbf{Y}}) \right) D_{N-\mathbf{Y}}(\varepsilon), \end{aligned}$$

که در آن
$$D_N$$
 دترمینان وارون ماتریس تابع گرین یـک بـسپار
منزوی به طول N است و با رابطهٔ زیر داده می شود [۲۰]
 $D_N(\varepsilon) = (\frac{\varepsilon - \tilde{\varepsilon}_C}{\beta_C})(1 - \delta^{r})^{(N-1)/r} \frac{\sin[(N+1)\phi/r]}{\sin(\phi/r)},$ (۱۳)
که در آن

$$\cos\phi = \frac{(\varepsilon - \tilde{\varepsilon}_C)^{\mathsf{Y}} - \mathsf{Y}\beta_C^{\mathsf{Y}}(\mathsf{Y} + \delta^{\mathsf{Y}})}{\mathsf{Y}\beta_C^{\mathsf{Y}}(\mathsf{Y} - \delta^{\mathsf{Y}})}.$$

با مشخص شدن عنصر $(G_P)_{i,N}$ ، در قسمت بعد به کمک روابط تحلیلی (۸) و (۹) به بررسی رسانش و چگالی حالتهای بسپار شانه-مانند با انرژی پرش متناوب در زنجیرهٔ اصلی (پلیاستیلن) می پردازیم.

.

در این بخش با استفاده از فرمولبندی قبل به بررسی ترابرد الکترونی از یک بسپار شانه–مانند با انرژیهای پرش متناوب در شاخهٔ اصلی میپردازیم. لازم به ذکر است که ایـن مـدل لزومـاً برای بررسی خواص ترابردی مولکول پلی استیلن نیست و برای تمام بسپارها یا نانو ساختارهای شانه مانندی که انرژی پرش آنها متناوب است قابل استفاده است. بنابراین در اینجا پارامترهای مورد نیاز برای انرژیهای جایگاهی و پـرش را بـه صورت نوعی انتخاب میکنیم که این امر در مقالات نظری نیـز بسیار رایج است [۱۹ و ۲۰]. البته برای تحلیل و توجیه نتایج تجربی به صورت موردی توسط این رهیافت، دانستن دقیق این پارامترها ضروری است. با توجـه بـه ایـن توضـیحات مقـادیر انرژیهای جایگاهی تمام اتمهای ساختار شامل هادیها را برابر صفر اختیار میکنیم. همچنین انرژی پرش بین اربیتال های اتمی در هادیها را برابر ۱eV، انرژی پرش برای پیوند کربن-۱ eV هيـدروژن را ۲۵ eV و مقـدار β_C در رابطـهٔ (۲) را ۱ eV هيـدروژن را انتخاب می کنیم. انرژی پرش اتصال ها را نیز برابر ۲۵ eV / ۰ در نظر مي گيريم.

نمودارهای شکل ۲ (الف) و (ب) رفتار رسانش و چگالی حالتهای پلی استیلن را بر حسب انرژی الکترون ورودی برای دو طول مختلف (۹ , ۷ = ۱ + ۲ × ۱) برای چند مقدار مختلف قدرت دوپارش نشان میدهد. همان طور که دیده می شود در درون پنجرهٔ انرژی بسپار، رفتار منحنی های چگالی حالت ها و رسانش، نوسانی بوده و خارج آن، رفتار رسانش نمایی یا تونل زنی است. در خارج از پنجرهٔ انرژی بسپار، تغییرات چگالی حالت ها بر حسب انرژی مستقل از اندازهٔ بسپار است. در مورد منحنی رسانش در ناحیهٔ تشدیدی افزایش اندازه بسپار اندازهٔ



شکل ۲. (الف) (*T*) و (ب) (DOS) بر حسب انرژی الکترون ورودی برای پلی استیلن –مانند دو طول متفاوت (N = ۲n + ۱ = ۷,۹) که متصل به دو سیم همگن و مشابه است. در اینجا همهٔ انرژی های جایگاهی برابر صفر در نظر گرفته شده است. انـرژی پـرش بـرای نـیمسیمها برابـر (L-) به دو سیم همگن و مشابه است. در اینجا همهٔ انرژی های جایگاهی برابر صفر در نظر گرفته شده است. انـرژی پـرش بـرای نـیمسیمها برابـر (L-) به دو سیم همگن و مشابه است. (*L*(R) به انرژی های جایگاهی برابر صفر در نظر گرفته شده است. انـرژی پـرش بـرای نـیمسیمها برابـر پرش بین نیمسیمها و بسپار ۲۵ و ۲۵ مستند.

میانی، انرژی جایگاهی بهنجار شدهٔ اتم کربن به بینهایت میل میکند.

در این قسمت سعی بر این است که با در نظر گرفتن انرژی های پرش متفاوت برای پیوندهای یگانه و دوگانه (قدرت دوپارش)، رسانش را بررسی کنیم. نمودارهای شکل ۳ (الف) و (ب) تغییرات T او log(DOS) را برحسب انرژی الکترون وردی برای دو مقدار مختلف قدرت دوپارش (δ)، برای یک بسپار قلههای تشدیدی را کاهش نداده و فقط تعداد آنها زیادتر می کند. مشاهده می شود که هرچه طول بسپار بیشتر شود رسانش تونلزنی در ناحیهٔ گاف کمتر می شود. این نمودار دارای سه گاف انرژی است، گاف میانی به دلیل ساختار شانه-مانند بسپار و گاف های سمت راست و چپ به دلیل ساختار متناوب این دستگاه است. بدیهی است با قرار دادن مقدار مفر برای انرژی پرش پیوند کربن میدروژن گاف مرکزی در دو گاف دیگر محو شده و بسپار تنها یک گاف از خود نشان می دهد. تونلزنی در گاف میانی بسیار ضعیف تر از دو گاف سمت راست و چپ است زیرا حول انرژی صفر در گاف



ε(eV)

شکل ۳. (الف) (T)و (ب) (Dog(DOS برحسب انرژی الکترون ورودی برای یک بسپار پلیاستیلن-مانند شامل هفت اتم کربن و متصل بـه دو هادی فلزی ایدهآل برای چند مقدار متفاوت قدرت دوپارش (۰/۷, ۰/۵, ۰/۷). در اینجا همهٔ انرژیهای جایگاهی برابر صفر در نظر گرفتـه شده است. انرژی پرش برای نیمسیمها برابر واحد (β_{L(R)} = ۱eV)، انرژی پرش برای بسپار: ۹۶ = β_C = ۶۶، و جملهٔ انرژی پرش بین نیمسیمها و بسپار ۷۵ ه/۰۵ است.

پلی استیلن – مانند شامل هفت اتم کربن نشان می دهد. نمودارها دارای سه گاف در طیف خود هستند که گاف مرکزی به دلیل ساختار شانه – مانند و دو گاف کناری به علت وجود تناوب در انرژیهای پرش است، به همین دلیل تغییر قدرت دوپارش تنها بر اندازهٔ دو گاف کناری تأثیر خواهد گذاشت. با افزایش مقدار قدرت دوپارش از ۲۳، به ۷/۰، درون این گاف هاتونلزنی الکترون سخت در می شود. همچنین ناحیهٔ تشدیدی دارای قلههای تیزتری می شود.

در طیف رسانش و چگالی حالـتهـا برحـسب انـرژی بـرای

نانوساختار شانه – مانند با انرژی پرش متناوب در شاخهٔ اصلی (پلی استیلن)، سه گاف انرژی مشاهده شد که گاف میانی به علت ساختار شانه –مانند این بسپار بوده و رسانش در این منطقه به صفر می رسد و دو گاف سمت راست و چپ به علت وجود پیوندها یگانه و دوگانه به صورت متناوب (دوپارش) در این بسپار است که با افزایش قدرت دوپارش گافهای وسیعتر و عمیق تری در طیف رسانش مشاهده شد و همچنین قلههای منطقهٔ تشدیدی تیزتر شدند. با افزایش طول بسپار رسانش تونلزنی تضعیف شد، ولی چگالی حالت ها در خارج پنجرهٔ انرژی با افزایش طول بسپار هیچ تغییری نمی کند.

410

شهركرد قدرداني مي شود.

- 11. W P Su, J R Schrieffer and A J Heeger, *Phys. Rev. Lett.* **42** (1979) 1698.
- 12. C Joachim and J F Vinuesa, *Europhys. Lett.*, **33** (1996) 635.
- 13. R Landauer, Phys. Lett. A 85 (1981) 91.

- 15. S Datta, "*Electronic Transport in Mesoscopic Systems*", Cambridge University Press, Cambridge (1997).
- 16. P A Lee and D S Fisher, *Phys. Rev. Lett.* **47** (1981) 882.
- 17. D S Fisher and P A Lee, Phys. Rev. B 35 (1987) 979.
- P D Kirkman and J B Pendry, J. Phys. C 17 (1984) 4327.
- 19. M Mardaani, H Rabbani and A Esmaeili, *Solid State Commun.* **151** (2011) 928.
- 20. M Mardaani and K Esfarjani, Chem. Phys. 317 (2005) 43.
- 21. D Nozaki, H M Pastawski and G Cuniberti, *New J. Phys.* **12** (2010) 063004.

- بدین وسیله از حمایت.ای مالی معاونت پژوهـشی دانـشگاه
- G Cuniberti, G Fagas and K Richter, "Introducing Molecular Electronics", Berlin and Heidelberg: Springer (2005).
- 2. L De Cola, "Molecular Wires: From Design to Properties", Berlin Heidelberg: Springer (2005).
- 3. Y Calev, H Cohen, G Cuniberti, A Nitzan and D Porath, *Isr. J. Chem.* 44 (2004) 133.
- 4. N D Lang, Phys. Rev. Lett. 79 (1997) 1357.
- 5. E Shapir, J Yi, H Cohen, A Kotlyar, G Cuniberti and D Porath, J. Phys. Chem. B 109 (2005) 14270.
- C K Chiang, C R Fincher Jr, Y W Park, A J Heeger, H Shirakawa, E-J Louis, S C Gau and A G MacDiarmid, *Phys. Rev. Lett.* **39** (1977) 1098.
- C K Chiang, M A Dury, S C Gau, A J Heeger, E-J Louis, A G MacDiarmid, Y W Park and H Shirakawa, J. Am. Chem. Soc. 100 (1978) 1013.
- D Nozaki, H M Pastawski and G Cuniberti, New Journal of Physics 12 (2010) 063004.
- Y Cui, Q Wei, H Park and C M Lieber, *Science* 293 (2001) 1289.
- H Shirakawa, E J Louis, A G MacDiarmid, C K Chiang and A J Heeger, J.C.S. Chem. Comm. 16 (1977) 578.